

# Установка атомно-слоевого осаждения Classic

Установка атомно-слоевого осаждения Classic

**Производитель:**

CN1

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Установка Classic предназначена для процессов термического атомно-слоевого осаждения (TALD - Thermal Atomic Layer Deposition) тонких пленок. Конфигурация установки позволяет работать с пластинами диаметром до 200 мм, а также прямоугольными подложками. Загрузка образцов в камеру осуществляется в ручном режиме. Имеется встроенная система подачи прекурсоров и рабочих газов. Управление системой осуществляется при помощи цветного сенсорного дисплея. Опционально доступна автоматическая загрузка пластин из кассеты или кластерная конструкция с несколькими модулями. Установка атомно-слоевого осаждения Classic является бюджетным и надежным решением для научно-исследовательских центров и лабораторий.

## Область применения

- Нанoeлектроника: осаждение оксидов, нитридов, металлов, барьерных и seed слоев.
- Новые разработки в области сенсоров, НЭМС, МЭМС, графеновых транзисторов, OLED.
- Оптические покрытия для фильтров УФ - ИК диапазона.
- Осаждение защитных и коррозионностойких покрытий.

## Особенности

- Конструкция рабочей камеры с горизонтальным потоком прекурсоров обеспечивает высокую равномерность по толщине пленки.
- Рабочая камера из алюминия для одиночной обработки пластин или прямоугольных подложек
- Регулируемая температура подложки 25 - 400°C.
- До 4 линий подачи прекурсоров и рабочего газа.
- Простой и понятный графический интерфейс пользователя на базе PLC и сенсорного дисплея для задания параметров технологического процесса

(рецептов).

- Простое сервисное обслуживание благодаря модульной конструкции установки.
- Опционально доступен встроенный генератор озона (O3).
- Совместимость с условиями чистых помещений.

<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
Размер пластин	50 - 200 мм Прямоугольные подложки *Другие размеры по запросу
Загрузка пластин	Ручная (open load)
Тип реактора	Рабочая камера с горизонтальным потоком
Температура нагрева подложки Температура нагрева стенок камеры	25 - 400°C макс. 150°C
Линии подачи прекурсоров	4 линии: 3 подогреваемые до 150°C (опция до 250°C) 1 без подогрева
Рабочие газы	Встроенный газовый шкаф на 4 линии с цифровыми РРГ
Вакуумная система Предельное давление Контроль давления	Сухая откачная система с подогревом Автоматический
Система управления	ПЛК и сенсорный дисплей с GUI-интерфейсом
Дополнительные опции	Групповая обработка до 25 пластин Автоматический шлюз загрузки пластин Кассетная загрузка пластин Дополнительные линии прекурсоров и рабочего газа Источник прекурсоров (барботер, испаритель, LDS)